

Agency Contact:

David Moreno

MCA

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: dmoreno@mcapr.com**GAUDA 社買収により D2S 社が先端半導体露光技術をフォトマスク製造に応用する GPGPU 高速化技術を強化**

SAN JOSE, Calif., June 3, 2014-電子ビームと汎用画像処理ユニット(GPGPU)技術を基礎としたコンピュータベースの設計プラットフォーム供給メーカーである D2S®社は、本日、米国カリフォルニア州サニーバールの GPGPU ベースのコンピュータリソグラフィー高速化技術の開発会社 Gauda, Inc. 社の資産を全て取得したと発表した。GPGPU 高速化に関する Gauda 社保有特許およびソフトウェアの取得は、先端フォトマスクの複雑なパターン形成に於いて、ウエハ上で期待される形状との比較による精度評価という今後より重要となる技術分野であるウエハ表面解析 (Wafer Plane Analysis) を含む半導体製造に対する D2S 社の能力を強化する。

「お客様やパートナーの方々のフィードバックは、より高精度なフォトマスク描画や高歩留りウエハ露光プロセスに対し、GPGPU 高速化は更に重要となる事を示しました」と D2S 社 CEO の Aki Fujimura 氏は述べた。「Gauda 社の買収は、弊社の TrueMask 製品群の能力を拡張し、GPGPU ベースの製品力を強化する重要な技術や知的財産(IP)を弊社にもたらずでしょう」

About D2S, Inc.

D2S は既存 eBeam 技術を最大限に利用し、少量生産および大量生産に対するマスク製造コストを削減するためのコンピュータベースの設計プラットフォームを供給するメーカーです。D2S TrueMask®ソリューションは、ウエハ高品質確保のために必要とされる複雑な形状を、既存の eBeam マスク描画装置を利用し、コスト効果高い描画時間で、28nm もしくはそれ以降の世代の先端フォトマスクの製造を可能とする製品です。D2S は eBeam Initiative の事務局を担っています。本社はカリフォルニア州サンノゼ市にあり、2007 年に創業しております。詳細に関しましては、:

www.design2silicon.com を参照ください。

###

D2S と D2S のロゴは、D2S, Inc.の登録商標です。 TrueMask と TrueModel は D2S, Inc.の商標です。